# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-228661

(43)Date of publication of application: 25.08.1998

(51)Int.CI.

G11B 7/135

(21)Application number : 09-030565

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing:

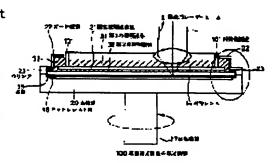
14.02.1997

(72)Inventor: KUROKAWA KOTARO

# (54) MASTER DISK MANUFACTURING ALIGNER FOR OPTICAL RECORDING MEDIUM

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance exposing accuracy of the master disk of an optical recording medium. SOLUTION: A liquid tight and fixed transparent shield plate 21 is provided between an objective lens 14 for exposure light and a photoresist layer 16, and 1st and 2nd transparent liquids 31 and 32 having light transmissibility of the exposure light are filled into between the objective lens 14 and the fixed transparent shield plate 21 and then the fixed transparent shield plate 21 and a substrate coated with the photoresist layer 16 respectively. Consequently, the 2nd transparent liquid is prohibited from flowing to the objective lens 14, while the 1st transparent liquid in contact with the objective lens does not flow (move) in spite of rotating of the substrate, so that an axial drift, etc., of the objective lens 14 does not take place.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本園特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許山壓公開發号

## 特開平10-228661

(43)公開日 平成10年(1998) 8月25日

(51) Int.CL4

G11B 7/135

Pi

G11B 7/135

Z

審査器水 未器水 高泉項の数9 OL (全 7 頁)

(21)出国番号

特額平9-30565

(22)出題日

平成9年(1997)2月14日

裁別至号

(71)出版人 000002185

ソニー株式会社

京京都品川区北品川6丁目7號35号

(72) 発明者 無川 光太郎

東京都品川区北品川6丁目7級35号 ソニ

一株式会社内

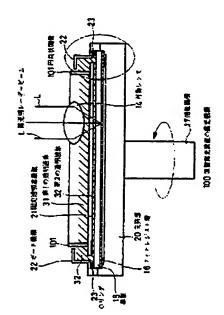
(74)代理人 弁理士 松股 旁垫

#### (54) 【発明の名称】 光学記録媒体の原盤作製用電光装置

#### (57)【要約】

【課題】 光学記録媒体作製用の原盤の露光の精度の向上を図る。

【解決手段】 選光光の対物レンズ14と、フォトレジスト層16との間に液密性を有する固定透明遮蔽板21を設け、対物レンズ14と固定透明遮蔽板21との間、および固定透明遮蔽板21とフォトレジスト層が塗布された甚板15との間とに、それぞれ電光光に対して光透過性を有する第1および第2の透明液体31および32を充填する。



#### 【特許請求の範囲】

【脚水項1】 光学記録媒体の後続四凸を形成する光学 記録媒体の原型作製用露光鉄畳において、

フォトレジスト層が塗布された基板の支持部と、 **延光光の対物レンズと、** 

該対物レンズと、上記フォトレジスト層が塗布された基 板との間に配置され、液密性を有する固定透明遮蔽板と を答し

上記対物レンズまたは上記芸板の支持部の少なくとも一 方に、上記対物レンズを通過して上記フォトレジスト層 16 に到来する露光スポットを、上記フォトレジスト層にお いて移行走査させる相対的移行手段を具備し、

上記対物レンズと上記固定透明退取板との間、および上 記固定透明退茲板と上記フォトレジスト層が塗布された 基板との間とに、それぞれ上記葉光光に対して光透過性 を育する第1および第2の週明液体が充填されたことを 特徴とする光学記録媒体の原盤作製用電光感伝。

【韻求項2】 上記基板の支持部が、上記基板をその面 内で回転させる回転支持体よりなることを特徴とする請 求項)に記載の光学記録媒体の原盤作製用露光装置。

【請求項3】 上記算1 および第2の透明液体は、その 屈折率が、空気の屈折率に比し上記対物レンズの屈折率 に近い屈折率を育する液体であることを特徴とする請求 項1に記載の光学記録媒体の原盤作製用露光装置。

【請求項4】 上記第1および第2の透明液体と、上記 フォトレジスト層が金布された基板と、上記園定透明退 あることを特徴とする請求項1に記載の光学記録媒体の 原型作製用露光装置。

【請求項5】 上記算1および第2の週明液体は、同一 の返明液体よりなることを特徴とする調求項1に記載の 光学記録媒体の原盤作製用電光装置。

【請求項6】 上記フォトレジスト層が塗布された基板 は、上記奪光光に対して光透過性を有する基板より構成 さわ

上記フォトレジスト圏が、上記対物レンズと対向する側 とは反対側に配置されて上記算2の透明液体と接触しな いようになされていることを特徴とする請求項1に記載 の光学記録媒体の原盤作製用葉光装置。

と上記対物レンズとは、屈折率が上記電光光に対して同 等である透明材料によって構成されたことを特徴とする 請求項1に記載の光学記録媒体の原盤作製用露光装置。

【請求項8】 上記フォトレジスト層が塗布された基板 は、そのフォトレジスト層が、上記対物レンズと対向す る側に配置されて上記算2の透明液体と接触するように なされ、

上記第2の透明液体は、上記フォトレジスト層が可溶性 を示さない透明液体よりなることを特徴とする請求項1 に記載の光学記録媒体の原型作製用露光装置。

【請求項9】 上記算2の週期液体は、上記固定週期退 蔽板の上部と下部とで、上記固定透明連戒板の外層部で 進過するように配置されて、

上記フォトレジスト層が墜布された套板の回転に伴う固 定遇明進蔽板の下部の第2の透明液体における進心力に よる外国方向への移動を、固定透明速高板の上部の第2 の週明液体によって阻止する構成としたことを特徴とす る請求項2に記載の光学記録媒体の原型作製用電光法

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学記録媒体の原 盤作製用葉光装置に係わる。

[0002]

【従来の技術】オーディオ用、ビデオ用、その他の各種 情報を記録するコンパクトディスク(CD)や、レーザ ーディスク(LD)等の従来の光学記録媒体において は、その情報記録圏にデータ情報、トラッキングサーボ **偉号等の記録がなされる位相ピット、ブリグループ等の** 微細凹凸の形成がなされる。

【0003】この錯報記録器を構成する微細凹凸は、光 学記録媒体の基板の射出成形と同時に形成したり、ある いは、フォトポリマリゼーション法、いわゆる2 P法等 によって形成されたりすることができる。

【①①①4】これらの射出成形あるいは2 P法において は、最終的に形成する微細凹凸を転写形成する微細凹凸 を育するスタンパーが用いられる。このスタンパーの作 製においては、先ず、原型の作製がなされる。この原盤 はこれを構成する基板、例えば研磨した平滑なガラス板 上にフォトレジストを塗布し、これをパターン競光し

て、尊細凹凸を形成し、その表面に倒えばAgメッキを 飽して成る。このようにして作製した原盤にメタルメッ キを縮し、これを剥離することによって、あるいはこの 繰り返しによってスタンパーの形成がなされる。

【0005】図4にその概略構成を示すように、この原 盤作製に際してのフォトレジストに対するパターン套光 を行う原盤露光装置50は、フォトレジストの感光する 波長の露光用レーザービームしを発生する露光レーザー ビーム発生源51と、露光パターン例えば記録情報に応 【語求項?】 上記フォトレジスト層が塗布された基板 46 じて変光用レーザービームしを変調する変調器52とが 節けられ、これにより例えば独度変調された露光用レー ザービームしを、ミラー5.3により反射させて、対物レ ンズ5.4 に向かわせ、この対物レンズ5.4 を通じて原盤 を作製する基板55上のフォトレジスト56面に露光用 レーザービームしを集束するようにして、微細な記録パ ターンの記録を行う。この従来における原盤露光装置に おいては、対物レンズ54と基板55上のフォトレジス ト56との間は、図5に示すように単なる空間、すなわ ち空気が介在された構成とされている。

50 【0006】一方、昨今、光学記錄媒体の高記録密度化

が進み、原盤の意光においても、より微細な位置調御、 すなわち露光用レーザービームしのスポットの微小化が 要求されている。

【0007】このように、露光用レーザービームしのス ボットの微小化。すなわち泉光力の向上を図るために、 図6に示すように、対物レンズ5.4と、フォトレジスト 56との間を高屈折率の媒体、例えば液体で満たした状 態で露光を行う波浸法、いわゆる抽浸法が提案されてい る.

しと、フォトレジスト面56の鉛直線とのなす角を&と し、対物レンズ5.4の関口数をN. A. とし、対物レン ズ54と、フォトレジスト56との間の媒体の屈折率を nとすると、フォトレジスト56面上に集光される蘇光 用レーザービームしの径のは、露光用レーザービームし の波長を入とするとき、下記(数1)により表される。 [0009]

【數1】 $\phi = (0.82 \times \lambda) / N.A.$ (但しN. A.  $= n \times s in \theta と する。)$ 

【0010】すなわち、対物レンズ54と、フォトレジ 20 スト56との間の媒体として、その屈折率 nが、空気の 屈折率(n。=1)よりも大きいものを適用すれば、対 物レンズ54の開口数N. A. が大きくなり、その結 早、ゆ(ビームしの径)の値を小さくすることができ、 **55.00円 10.00 10** きるのである.

#### [0011]

【発明が解決しようとする課題】一方、上述したよう に、フォトレジストの露光用レーザービームしによる露 光を行う場合には、対物レンズ5.4と、基板5.5とを、 相対的に移動させる必要がある。例えば、円盤状の基板 55を用いた場合においては、基板55を回転しつつ、 露光用レーザービームしを書板55の半径方向に移動さ せて、フォトレジスト面上にスパイラル状にレーザービ ームスポットを走査させる。

【0012】しかしながら、上述した液浸法を用いてフ \* トレジストの露光を行う場合において、対物レンズ5 4と、基板55とを、相対的に移動させると、対物レン ズ54と、フォトレジスト56との間の高屈折率の液体 が、芸板55の移動、例えば回転に引きずられて助く。 このとき、対物レンズ54がこの高屈折率の液体の動き に迎らうように存在していることから、液体の動きによ って対物レンズ5.4 に軸ぶれや、オートフォーカス動作 の乱れ等、対物レンズの動作に影響が生じることにな

【0013】このように対物レンズ54の軸ぶれ等が生 じた状態で、フォトレジストの露光を行うと、最終的に 得られる光学記録媒体はトラックピッチむらや再生信号 の変調度のむら等、粗悪な信号特性を有するものとな

【0014】そこで、本発明においては、液浸法を用い てフォトレジストの蘇光を行う場合において、蒸光用レ ーザービームしの集光力の向上を図り、かつ対物レンズ 54の勤ぶれや、オートフォーカス動作の乱れを回避し た光学記録媒体の原盤作製用基光基置を提供する。

#### [0015]

【課題を解決するための手段】本発明による光学記録館 体の原盤作製用整光装置は、フォトレジスト層が塗布さ れた春板の支持部と、露光光の対物レンズと、対物レン 【0008】この図6において、露光用レーザービーム(19)ズと、フォトレジスト層が塗布された書板との間に配置 され、液密性を有する固定透明遮蔽板とを有し、対物レ ンズまたは基板の支持部の少なくとも一方に、対物レン ズを道過して上記フォトレジスト層に到来する意光スポ ットを、フォトレジスト層において移行走査させる相対 的移行手段を具備し、対物レンズと固定透明過高板との 間、および固定週明越蔽板とフォトレジスト層が盤布さ れた器板との間とに、それぞれ蘇光光に対して光透過性 を有する第1および第2の週期液体が充填された構成と する.

> 【①①16】上述の本発明構成によれば、露光の際にフ ォトレジスト層が途布された基板の回転に合わせて流れ る第2の透明液体と対物レンズとの間に、固定透明退蔽 板を設けたため、第2の遮明液体の流れを対物レンズに 伝えないようにすることができ、対物レンズが接してい る第1の透明液体は、基板が回転するにもかかわらず、 流れ(動き)を生じることがないので、対物レンズ5.4 の軸ぶれ等を生じることなく、液浸法の実現、すなわち 露光用レーザービームLの景光力の向上を図った光学記 録媒体の原盤作製用露光装置を真現することができる。 30 [0017]

【発明の真施の形態】本発明の具体的な真施の形態につ いて説明する。以下において、ディスク状、いわゆる円 盤状の光ディスクを作製する場合に、射出成形法、ある いは2P法による使用するスタンパーを転写して作製す るガラス基板上のフォトレジスト面のパターン露光に過 用する場合について説明するが、本発明における原盤作 製用電光装置は、この形状に限定されるものではなく、 光磁気ディスク、相変化ディスク、その他カード状、シ ート状等の、微細凹凸を情報記録層に有する各種光学記 録媒体の作製に用いる原盤を露光する場合に適用するこ とができる。

【①①18】本発明の一実施例を説明する。図1に本発 明の原盤作製用電光装置の概略模成図を、図2に本発明 の原型作製用電光装置における露光機構の機略断面図を 示す。

【0019】本発明の原盤作製用露光装置10において は、図1に示すように、露光用レーザービームしを発生 する葦光レーザービーム発生源11と、露光パターン例 えば記録情報に応じて露光用レーザービームしを変調す 50 る変調器12とが設けられ、これにより例えば強度変調

された露光用レーザービームしを、ミラー13により反 射させて、図1中の破線で囲まれた電光鉄梯100にお いて、露光がなされる。

【0020】ここで、露光機構100は、露光レーザー ピームしを集光する対物レンズ14.フォトレジスト1 6が塗布された毎板15と、基板16を支持する支持部 20と、対物レンズ14と書板15との間に配置された 液密性を有する固定透明遮蔽板21とからなり、対物レ ンズ14の集光側の面と固定透明退蔽板21との間に は、第1の透明液体31が充填され、固定透明遮蔽板2 10 1とフォトレジスト屋16が塗布された基板15との間 には、第2の適明液体32が充填されている機成を有す るものである。

【0021】本発明の原盤作製用露光装置10における 上記窓光機構100の機略構成図を図2に示す。

【0022】すなわち、図2に示す電光機構100にお いては、フォトレジストが塗布されたフォトレジスト面 16を有する基板15、例えば石英ガラスよりなる基板 が、支持部20により支持される。との支持部20は、 例えば上面に基板15を収容配置する凹部が設けられた 20 円板体よりなり、その中心軸を中心として回転できるよ うに支持され、回転機構17例えばモーターの回転軸に 連結されて回転するようになされる。

【0023】一方、ミラー13と、軽光用レーザービー ムしを集光する対物レンズ14は、支持部20の半径方 向と平行する方向に移動するようになされる。このよう にして支持部20による基板15の回転と、ミラー13 および対物レンズ14の移動との共動によって、フォト レジスト屋16において露光用レーザービームしを移行 走査する相対的移行手段が構成される。これちの対物レーの とき 第1の透明液体31と、第2の透明液体32と ンズ14と、芸板15とは、露光光に対して屈折率が同 等である透明付料によって構成することが望ましい。

【0024】固定透明退蔽板21は、支持部20すなわ ち蟇板 15の回転に影響されずに静止状態を保持する機 成となっている。図示の例では、この固定透明遮蔽板2 1上に円筒状側壁101が液密に配置されてこの固定透 明遮蔽板21と側壁101によって第1の透明液体31 が収容される。

【0025】対物レンズ14と固定透明遮蔽板21との 定退明越蔽板21とフォトレジスト層16が塗布された 基板15との間には、第2の透明液体32が充填されて いる。これらの第1および第2の透明液体31および3 2は、それぞれ窓光光に対して光透過性を有するものと する.

【0026】固定透明返蔽板21は、例えば石英ガラス によって構成することができるが、この固定透明遮蔽板 21は、対物レンズ14と屈折率が同等ないしは近い透 明嘉板によって構成する。この第1の週明液体3 1 およ

率よりも対物レンズ14の屈折率に近いもので、さらに 基板 15、固定返明進茲板 21のそれぞれの屈折率と同 等である液体、倒えばベンゼンを使用することができ る.

5

【0027】また、フォトレジスト磨16の露光を行う 場合に基板の支持部20を回転機構17により回転させ た際に、第2の週期液体32が原盤作製用露光装置10 の外側に飛散しないようにガード機構22が設けられて いる。また、第2の透明液体32は、固定透明遮蔽板2 1と菩板15との間に充填されると共に、その水面が固 定退明進設板21の露光に関与しない円筒状側壁101 外の周辺部において、固定透明遮蔽板21の上部に回り 込むように充填されている。

【0028】また、第2の週明液体32が基板15の側 面を回り込み、フォトレジスト層16側に入り込むこと を回過するため、基板15とガード機構22との間に は、例えばロリング23を配置する。

【0029】上述したような構成を育する原盤作製用露 光装置10を用いて、基板15上に塗布されたフォトレ ジスト16の窓光を行う場合について説明する。

【0030】図1に示した露光レーザービーム発生源1 1から露光用レーザービームしを発生させ、所定の露光 パターンに応じて、この電光用レーザービームしを変調 器12により変調する。そして、変調された露光用レー ザービームしは、ミラー13により対物レンズ14に導 入されて対物レンズ14により集光されるようにする。 【0031】図2に示すように、フォトレジスト16が 塗布された基板15は、回転機構17により回転する支 特部20に設置されて所定の回転数で回転させる。この は、固定透明遮蔽板21によって遮断されている。この 固定透明退蔽板21が基板15の回転に合わせて流れる 第2の透明液体の流れを第1の透明液体31に任えない ようにしているため、第1の透明液体31には流れが生 じることなく、篩止した状態を保つことができる。すな わち、固定透明遮蔽板21によって、第2の透明液体3 2の流れを対物レンズ14に伝わることが回避され、ブ レや振動が生じない。

【0032】図3に、図2中の長円で囲まれた部分の拡 間に、この第1の透明液体31が充填される。また、固 40 大図を示す。この図3に示すように、第2の透明液体3 2は、固定透明遮蔽板21の周辺上部と下部とで、固定 透明遮蔽板の外層部で連迫するように配置する。これに より、フォトレジスト層16が塗布された基板15の回 転に伴う固定透明返蔽板21の下部の第2の透明液体3 2における途心力による外周方向への移動を、固定透明 退藏板21の上部に配置された第2の透明液体32によ って阻止することができる。

【0033】すなわち、益板15が回転すると、図3に 示すように、固定透明遮蔽板21とフォトレジスト層1 び第2の透明液体32は、これらの虚折率が空気の屈折。50~6が塗布された菩板15との間に充填された第2の透明

液体32は、回転により生じた速心力によって外層側に 引き寄せられ、これによって、固定退明遅蔽板21に挽 みが生じ、固定退明越蔽板21と基板15との間隔に変 動を来すとか、固定透明遮蔽板21に破損を生じさせ

【0034】また、固定透明退散板21と、基板15と の距離は極めて小に選定されているため、固定透明遮蔽 板21と基板15との間の、第2の週明液体32の量が 少なくなると、固定透明遮蔽板21と套板15とが略接 触した状態となるため、固定透明退茲板21が基板15 の回転に影響されてしまい、静止した状態を保持できな くなってしまう。

【0035】これに対し、上述の本発明構成によれば、 固定透明遮蔽板21よりも上部国辺の第2の透明液体3 2も蓄板15の回転により生じた途心力によって外国側 に引き寄せられることから、固定透明遮蔽板21よりも 上部の第2の退明液体32の液量を調整することによっ て、上述した固定透明遮蔽板21と書板15との間に充 填された第2の透明液体32の遠心力を相殺することが でき、外国方向へ移動することを阻止し、固定透明遮蔽 26 板21と基板15との間の、第2の透明液体32の量が 少なくなることを回避できる。

【0036】上述したように、回転機構17によって基 板15を回転させた状態で、入射された露光用レーザー ビームしは、第1および第2の透明液体31および3 2. 固定透明遮蔽板21. 套板15を介してフォトレジ スト16に集光されて、露光がなされ、微細凹凸が形成 される。その後その表面に例えばAgメッキを絡して原 盤が作製される。このようにして作製された原盤にメタ ルメッキを施し、これを別能することによって、あるい 30 はこの繰り返しによって、光学記録媒体の微細凹凸を転 写するためのスタンパーの形成がなされる。

【0037】上述のように、蘇光光の景光を行う対物レ ンズと、フォトレジストとの間を第1および第2の透明 液体31および32を介してフォトレジストの露光を行 うと、これらの屈折率は空気の屈折率よりも大とするこ とができるので、図6および(数1)において説明した ように、蘇光ビームしのスポット径を小さくすることが できる。これにより、より精密な露光副御が可能とな る。上述した実験例においては、第1および第2の透明 46 液体31および32として、ベンゼンを使用しており、 このベンゼンの屈折率は1.5である。よって、(数 1) より、露光ビームしの径を空気を介して露光した場 台に比べて1/1.5になる。すなわち、光学記録媒体 の情報記録密度の観点では、線密度を1.5倍、面密度 を2.25倍にすることができる。

【0038】また、特に本発明においては、フォトレジ スト層16が塗布された芸板15の回転によって流れが 生じてしまう年2の透明液体32と、対物レンズ14と の間に、第2の週明液体32の流れを対物レンズ14に 55 り、フォトレジスト層16が途布された基板15の回転

伝えない効果を有する固定透明遮蔽板21を設けたた め、対物レンズ14が接している第1の透明液体31 は、芸板15や対物レンズ14の相対的な移動にもかか わらず、流れが生じないので、対物レンズ14の軸ぶれ 等を生じることなく、安定して確実に所定のパターンを もって、所定の位置への露光を行うことができる。

8

【0039】上述した真餡倒においては、第1の週明液 体31、第2の週明液体32として、同一のもの、すな わちベンゼンを用いた場合について説明したが、本発明 この例に限定されることなく、これらの透明液体が、器 光光に対して光返過性を育し、かつ等しい屈折率を有す るものであれば、異なる液体を使用することができる。 【0040】上述した実施例においては、フォトレジス ト磨16を塗布した15を、フォトレジスト層を塗布し た側が対物レンズ14と対向する側とは反対側になるよ うに配置されて、第2の週明液体32と接触しないよう になされている場合について説明したが、本発明はこの 例に限定されることなく、春板15をそのフォトレジス ト磨16が対物レンズ14と対向する側になるように配 置されて、第2の透明液体32と接するようになされた 機成とすることもできる。但し、この場合においては、 フォトレジスト層16と直接接触する第2の透明液体3 2は、フォトレジスト16に対して不溶性のものを使用 することが必要である。このように、フォトレジスト層 16を対物レンズ14と対向するように基板15を設置 した場合、フォトレジスト層16と、対物レンズ14を 上述の英施例よりも近接した状態で超光をすることがで きるため、より微細なパターンの露光が可能となる。 [0041]

【発明の効果】本発明によれば、光学記録媒体用の原盤 作製用露光装置において、液浸法を採り入れたことによ り、窓光用レーザービームしの集光力の向上を図ること ができた。また、基板と、対物レンズとの間に固定透明 遮蔽板を設けたことによって、液浸法によるにもかかわ らず、基板の回転による第1の液体の流れを、対物レン ズに伝えないようすることができ、対物レンズの軸ぶれ や、オートフォーカス動作の乱れを効果的に回避するこ とができた。

【0042】また、フォトレジスト層16を対物レンズ 14と対向するように基板15を設置し、フォトレジス トが第2の透明液体32と接触するようになされた機成 とすることにより、フォトレジスト層16と、対物レン ズ14との距離をより近接した状態として基光をするこ とができるため、より微細なパターンの露光が可能とな った。

【りり43】また、本発明は、第2の透明液体32を、 固定返明進戒板21の上部と下部とで、固定透明連戒板 の外層部で連迫するようにし、この固定透明過高級21 の上部の第2の週明液体32の量を関節することによ

(5)

特関平10-228661 19

に伴う固定透明遮蔽板21の下部の第2の透明液体32 における途心力による外周方向への移動を、固定透明進 **敬板21の上部の第2の透明液体32の基板の回転によ** り生じた途心力によって阻止することができ、固定透明 通惑板21と音板15との間の、第2の透明液体32の 量が少なくなることを回退できた。

#### 【図画の簡単な説明】

【図1】本発明における原盤基光装置の機略構成図を示

図を示す。

【図3】本発明における原盤露光英麗の要部の概略構成 図を示す。

【図4】従来における原型電光装置の側略構成図を示 \*

\* 5.

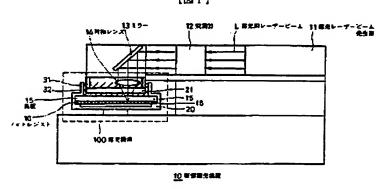
【図5】従来における原盤変光接近の要部の機略構成図 を示す。

【図6】液浸法を用いた場合に従来における原盤氮光基 置の要部の機略構成図を示す。

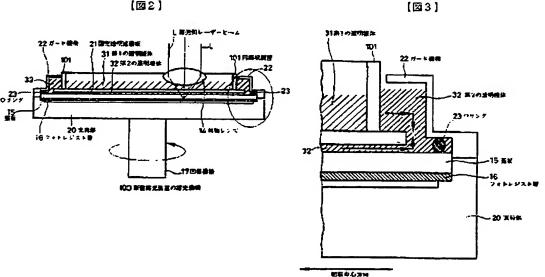
#### 【符号の説明】

10.50 原型露光装置、11.51 露光レーザー ビーム発生源、12,52 変調器、13,53 ー、14,54 対物レンズ、15、55 基板、1 【図2】本発明における原型露光装置の要部の概略構成 19 6、56 フォトレジスト、17 回転機構、20 基 板の支持部、21固定透明速蔽板、22 ガード機構、 23 0リング、100 原盤葉光装置の葉光機構、1 0.1 円筒状側壁

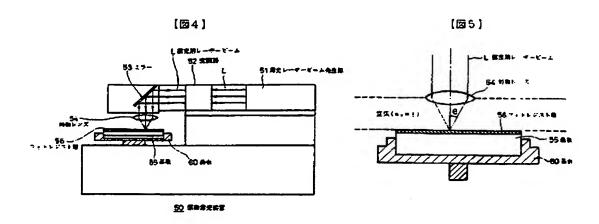
[21]

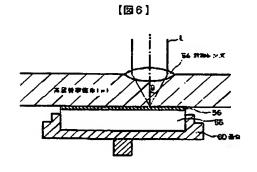


[図2]



(2) 特別平10-228661





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: \_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.